

## 第20回 ホソカワ粉体工学シンポジウム 「乾燥、粒子複合化」

- 日時: 2013年7月11日(木) 講演会 14:30~17:00  
懇親会 17:00~18:30
- 場所: ホソカワミクロン株式会社 枚方本社
- 主催: 粉体技術談話会
- 後援: ホソカワミクロン株式会社
- 実施: (公財)ホソカワ粉体工学振興財団

### ◆プログラム:

14:30~14:40

開催の挨拶 粉体技術談話会会長 京都大学名誉教授 増田 弘昭  
趣旨説明 同 幹事 同志社大学教授 日高 重助

(司会:日高教授)

14:40~15:40 (講演40分、質疑20分)

低温度かつ高速度乾燥プロセスの基礎と応用

静岡大学大学院工学研究科

化学バイオ工学専攻准教授 立元 雄治

食品原料など熱に敏感な材料は低温度で乾燥しなければならないが、一般に乾燥速度が低く、長時間を要する。そこで低温度でありながら高速度で乾燥する方法の開発が望まれる。低温度・高速度乾燥法の考え方および既存の方法を解説するとともに当研究室で検討している減圧過熱水蒸気流動層乾燥法についても紹介する。

(司会:内藤教授)

15:40~16:40 (講演40分、質疑20分)

粒子複合化による先進セラミックス材料の開発

横浜国立大学 大学院環境情報研究院

人工環境と情報部門 循環材料学分野教授 多々見 純一

先進セラミックス材料の特性は微構造に極めて敏感であり、ナノ粒子の均一分散は喫緊の課題である。本講演では、機械的処理によるナノ複合粒子の調製と、これを用いた先進セラミックス材料の高機能化・多機能化について、いくつかの実例を挙げながら報告する。

16:40~17:00

総合討論

(司会:内藤教授)

17:00~18:30

懇親会